
CWAJ 版画展 70 周年記念

CWAJ アーティスト・イン・レジデンス プログラム

2027

@米国 コロラド州 スティームボート・スプリングス Oehme Graphics

CWAJ 現代版画展が 2027 年 10 月に第 70 回を迎えるにあたり、過去 70 年間にわたり CWAJ を支えてくださったアーティストの皆様への感謝を込めて、アーティスト・イン・レジデンスプログラムを提供することになりました。豊かな自然に囲まれたコロラド州の版画工房に 2 週間滞在し、全米で高い評価を受けるマスタープリンターのスー・オーメ氏とともに制作活動を行うプログラムです。制作と現地の人々との交流を通じて表現の幅を広げつつ、新たな地平を切り拓いてください。



写真左：スー・オーメとプリントマネジャーのデディ・ベンソン、
夏季インターンのティアンシン・シュー

写真中：スティームボート・スプリングスのダウンタウン

写真右：スタジオ 2 階の AIR 滞在者用アパート

1. 概要

CWAJ アーティスト・イン・レジデンス (AIR) プログラム 2027 は、過去に CWAJ 版画展に出展経験があり、日本国籍者または特別永住者として現在日本に居住している方が対象です。選ばれた 1 名のアーティストは、コロラド州スティームボート・スプリングスに 2 週間滞在し、オーメ・グラフィックスのマスタープリンターであるスー・オーメ氏と共に版画制作を行います。日程は 2027 年 5 月から 9 月の間で、アーティストとオーメ・グラフィックスとの合意により決定します。応募に年齢制限はありません。滞在中は個室が提供され、航空運賃は CWAJ が最大 325,000 円まで補助します。プログラムは英語で行われます。

選出されたアーティストには、以下の機会が与えられます：

- 全米に認められたマスタープリンターと共に制作を行う
- プロフェッショナルなスタジオ環境で新作を制作する
- 革新的な版画技法やプロセスを学ぶ
- 専門的な機材や施設を利用する
- 個別の指導や芸術的なフィードバックを受ける
- 経験豊富な現地のアーティストたちと交流する
- 米国での芸術的・文化的交流を体験する

2. 日程

- 2027 年 5 月 1 日から 9 月 30 日の間の 2 週間
- 選考後、アーティストとオーメ・グラフィックスの双方にとって都合の良い日程を調整します。

3. 応募資格

応募者は以下の条件を満たす必要があります：

- 過去に CWAJ 現代版画展、併設展、特別展、ヤング・プリントメーカー賞、ロロ・ピアーナ女性アーティスト賞等に入選・出展経験のある版画家
- 日本国籍者または特別永住者として、現在日本に居住していること。
- 英語で基本的な意思疎通ができ、積極的に対話をする意欲があること。
- 年齢制限なし。ただし、プログラムの運営上、自力で E メールおよびインターネットを使用し、オンライン面接に対応できる方に限る。

4. 応募方法

応募用紙のダウンロード：<https://cwaj.org/AIR>

応募締切：2026 年 11 月 9 日

応募内容：

- エッセイ形式の質問 2 問を含む応募用紙に必要事項を記入してください
- 過去の CWAJ 現代版画展に出展した作品 1 点を含む、オリジナル版画 5 点の画像のポートフォリオを提出してください。
- 最終選考通過者には、12 月 12 日にオンライン面接を行います。最終選考通過者には 12 月 5 日に通知しますので、12 月 12 日の午前中は面接時間として空けておいてください。

ご質問、ご相談がある場合は、AIR@cwaj.org までお気軽にご連絡ください。

選考日程：

- 応募締切：2026 年 11 月 9 日
- 最終選考通過者への通知：2026 年 12 月 5 日
- 最終選考通過者へのオンライン面接：2026 年 12 月 12 日午前
- 受賞者発表：2026 年 12 月中旬～下旬

5. プログラムの内容

レジデンス期間中には以下が無償で提供されます。

- オーム・グラフィックスでの 2 週間の滞在制作（版種は 8 を参照のこと）
- マスタープリンターのオーム氏による毎日の指導とコラボレーション
- スタジオの施設、機材、版画制作用資材の全面的な利用
- スタジオの上階にある、個室付きシェアアパートでの宿泊
- 作業日の朝食および昼食（朝食は食材のみ提供）
- 往復航空券の費用として最大 **325,000 円**の支給
- スティームボート・スプリングスおよびロッキー山脈を散策する機会

レジデンス終了後には以下の機会が提供されます。

- 2027 年 10 月に開催される第 70 回 CWAJ 現代版画展のオープニングレセプションへの招待
- 2028 年（状況によっては 2027 年）CWAJ 現代版画展での作品展示と、AIR 体験を語る講演の機会

受け入れ先：スー・オーム（マスタープリンター／オーム・グラフィックス代表）：

マスタープリンターとして 40 年近くの経験を持つスー・オームは、その豊富な知識と技術をオーム・グラフィックスでの版画制作プロジェクトに注いでいます。スタジオでの制作時間のほぼすべての場面に通底しているのが、「協働」という考え方です。技法、色彩、イメージについての判断は、共有の場で話し合いながら決められ、そこに集うすべての人が自分の考えやアイデアを出し合います。一つの課題に複数の頭脳で取り組むことこそが、最良の解決策を見出す力になると信じているからです

OG でのレジデンス期間中、アーティストたちは自身のイメージを実現するための多様な新しい手法や、色の組み合わせ、インクの調合について新たな発見をし、それぞれの制作活動に持ち帰るための新しいアイデアを頭の中に芽吹かせながらスタジオを後にすることになるでしょう。アーティストがさらなる探求への足がかりとなる何か新しいものを見出したとき、そのプロジェクトは成功したと言えるのです。

6. オーム・グラフィックスにはどのような設備がありますか？

オーム・グラフィックスは、米国屈指のプロフェッショナルな版画スタジオの一つです。制作できる版種は以下の通りです。

エッチングなどのインタリオ、木版・リノカットなど凸版、各種コラグラフおよびモノプリントと、その組み合わせ。シルクスクリーン制作も可能ですが、オーム氏以外のプリンターが補助します。

注意：リトグラフ制作はできません。

工房には以下の設備があります：

- Takach 社製エッチングプレス 2 台
- プロ仕様のアクアチント設備
- 換気設備完備のエッチング室
- 広々としたアーティスト用作業スペース
- 豊富な版画用紙
- 充実した画材の提供

7. アーティストの自己負担費用

選出されたアーティストは、以下の費用を負担する必要があります：

- 夕食（プログラム中、夕食は提供されませんが、キッチンを利用可能です）
- 旅行保険
- 医療保険
- 個人的な経費
- AIR プログラム前後の任意の個人旅行
- 特殊な画材や紙、道具を使用される場合は、ご自身でお持ちください。

8. AIR アーティストに期待されること

レジデンス期間中、選出されたアーティストは以下のことに取り組む必要があります：

- スー・オーメおよびスタジオスタッフとの協働
- 日本の版画技法に関する知識の共有
- 新しい版画技法の探求
- レジデンス期間中に、エディションのある版画やモノプリントを含む一連の作品群を制作すること
- オーメ・グラフィックスのアーカイブ用に、版画 1 点（モノプリントも可）を寄贈すること
- 要請があった場合、写真撮影、インタビュー、またはビデオ記録に参加すること
- 英語で基本的なコミュニケーションが取れ、積極的に会話に参加する意欲があること

レジデンス終了後、アーティストには以下のことが義務づけられています。

- レポートの提出
- CWAJ イベントにおいて、レジデンス体験に関する報告を行うこと
- 翌年の CWAJ 現代版画展で作品を展示すること
- レジデンス中に制作した作品 1 点を CWAJ に寄贈すること
- レジデンスの様子を記録した写真やビデオを共有し、CWAJ が広報目的に使用することを承諾すること

9. スー・オーメについて

オーメ・グラフィックス Oehme Graphics およびスー・オーメに関する詳細情報は、以下のサイトからご覧いただけます：

- Oehme Graphics ウェブサイト：www.oehmegraphics.com
- スー・オーメへのインタビュー：<https://www.youtube.com/watch?v=ZbJpP5MPiNg>
- 「オーメ・グラフィックスでの制作方法」動画シリーズ：
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLjBOMPYAnMfLdX9OKznBE9V1vd0WNjDZc>
- アーティストの制作過程動画：
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLjBOMPYAnMfKsTJIu4NTXSf2SXm5nQKoy>

10. CWAJ について

一般社団法人 CWAJ（カレッジ・ウイメンズ・アソシエーション・オブ・ジャパン）は 70 年近くにわたり、非営利ボランティア団体として、現代版画展、教育プログラム、文化交流を通じてさまざまな社会貢献活動を行っています。CWAJ 現代版画展の純益は、奨学金や助成金の財源となり、これまでに **900 名以上の国内外の学生、視覚障害のある学生、版画作家**を支援してきました。

第 70 回 CWAJ 現代版画展は、2027 年 10 月に代官山のヒルサイド・フォーラムで開催し、オンラインギャラリーも同時に公開されます。「**CWAJ アーティスト・イン・レジデンスプログラム 2027**」は、日本の現代版画の振興と、日本と世界とのつながりを育むという CWAJ の取り組みに繋がるものです。

著作権について： CWAJ アーティスト・イン・レジデンスに参加するアーティストは、過去の CWAJ 現代版画展出展作品およびこれから寄贈される作品の画像を、CWAJ が図録の制作および同版画展の広報・宣伝の目的で、無償かつ期間の定めなく、非独占的に利用すること（CWAJ ウェブサイト、ソーシャルメディア、動画、デジタル・アーカイブ、その他 CWAJ の発行物への掲載を含む）にあらかじめ同意したものとします。

個人情報の取り扱いについて： CWAJ は、個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」とその他の関係法令及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」その他国が定める指針を遵守した上で個人情報を適切に取扱います。